OPTICAL SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent number:

JP8139367

Publication date:

1996-05-31

Inventor:

YOSHIOKA YASUO

Applicant:

SHARP KK

Classification:

- international:

H01L21/60; H01L33/00; H01L21/02; H01L33/00; (IPC1-

7): H01L33/00; H01L21/60

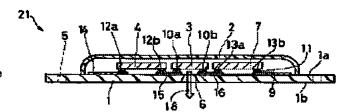
- european:

Application number: JP19940279518 19941114 Priority number(s): JP19940279518 19941114

Report a data error here

Abstract of JP8139367

PURPOSE: To provide an optical semiconductor device which facilitates high density wiring and mounting and, further, facilitates miniaturization of the device. CONSTITUTION: A slit 6 is so formed in a board 1 in an optical semiconductor device 21 as to have its aperture area gradually increased from one surface 1a side to the other surface 1a side of the board 1. The light emitting part of an LED chip 3 is mad to face the slit 6. The bumps 10a and 10b of the LED chip 3 are electrically connected to wiring patterns 15 and 16 with a conductive paste 11 and the LED chip 3 is driven by respective IC chips 4 and 7. A light emitted from the light emitting part of the LED chip 3 is emitted in the direction 18 of emission through the slit 6.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-139367

(43)公開日 平成8年(1996)5月31日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 33/00

21/60

N

44

311 S 7726-4E

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平6-279518

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

(22)出顧日

平成6年(1994)11月14日

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 吉岡 靖雄

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

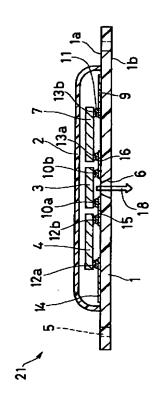
(74)代理人 弁理士 西教 圭一郎

(54) 【発明の名称】 光半導体装置

(57)【要約】

【目的】 高密度の配線および実装を行うことができ、 かつ装置の小型化を図ることができる光半導体装置を提 供する。

【構成】 光半導体装置21における基板11は、一方表面1a側から他方表面1b側に向けて開口面積が増大するようにスリット6が形成される。LEDチップ3は、発光部をスリット6に向け、かつバンプ10a,10bが配線パターン15,16に導電性ペースト11を介して電気的に接続され、各ICチップ4,7によって駆動される。LEDチップ3の発光部から出射される光は、スリット6を通過して出射方向18へと出射される。



40

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に光半導体素子および接続用バンプ を備える光半導体チップと、

光半導体素子に対応する開口形状の透孔および接続用バンプに対応する電極パッドが一方表面側に設けられ、前記透孔は他方表面側に向かって開口面積が増大するように形成される合成樹脂成型基板とを含み、

前記光半導体チップは、前記合成樹脂成型基板上に接続 用バンプと電極パッドとの間のフェイスダウンボンディ ングによって搭載されることを特徴とする光半導体装 置。

【請求項2】 前記光半導体チップには、光半導体素子 としてLEDアレイが形成され、

前記合成樹脂成型基板には、LEDアレイを構成する複数のLED素子に個別的に対応して、複数のスリット状の透孔が形成されることを特徴とする請求項1記載の光半導体装置。

【請求項3】 前記合成樹脂成型基板の透孔には、光透 過性の合成樹脂が充填されることを特徴とする請求項1 または2記載の光半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、家電製品やゲーム機器などの民生機器、コンピュータ、ワードプロセッサおよびファクシミリ装置などの情報通信機器、自動車用などに使用される光半導体装置に関し、特に高精細な表示を行い、かつ小型・軽量であるLEDアレイなどの光半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のLED(Light Emitting Diode) 表示装置におけるLEDチップの基板へのLEDの搭載 方法としては、第1の方法としてワイヤーボンドアッセ ンブルによる搭載法があり、第2の方法としてフェイス ダウンボンディングによる搭載法がある。

【0003】図12は第1の搭載法であるワイヤーボンドアッセンブルによってLEDチップが搭載された光半導体装置111の平面図であり、図13は図12における切断面線XIII—XIIIから見た断面図であり、図14は図12における切断面線XIV—XIVから見た断面図である。

【0004】光半導体装置111は、ガラスエポキシなどによって形成される硬質基板100とカバー104とを含んで構成される。硬質基板100には、半導体装置111を他の部材に固定するための取付穴105が硬質基板100の4隅に設けられ、また一方表面100aには所定の配線パターン109が形成される。硬質基板100の一方表面100aにはLEDチップ101が、硬質基板100の一方表面100aの中央部または任意の位置で、かつ配線パターン109上に導電性ペースト110によって実装される。さらに、LEDチップ101

の両側に、それぞれIC(集積回路)チップ102が導電性ペースト110によって基板パターン109上に実装される。各ICチップ102には、導線112を介して外部からLEDチップ101を駆動するための電流が供給される。LEDチップ101と各ICチップ102とをそれぞれ導線103によって電気的に接続することでLEDチップ101の発光状態を制御することができ

【0005】硬質基板100上に実装された各構成要素を覆うように、透光性の材料によって形成されるカバー104を設置する。カバー104によって各構成要素は外界から保護される。また、カバー104によって各構成要素が係食しない。LEDチップ101は、駆動用の電流が供給されることによって矢符113で示される出射方向へと、カバー104を介して光を出射する。

【0006】図15は第2の搭載法であるフェイスダウンボンディング方式によってLEDチップが搭載された光半導体装置121の平面図であり、図16は図15に20 おける切断面線XVI-XVIから見た断面図であり、図17は図15における切断面線XVII-XVIIから見た断面図である。

【0007】光半導体装置121はガラス基板106 と、ガラス基板106を取付ける取付枠107と、カバー125とを含んで構成される。ガラス基板106の一 方表面106aには所定の配線パターン126が形成される。

【0008】LEDチップ122および各ICチップ123は、前述した第1の搭載法における構成要素であるLEDチップ101および各ICチップ102とそれぞれ機能的には同一であるが、接続用の電極に直径 $20\sim30\mu$ m程度の大きさである凸状のバンプ124が形成される。

【0009】LEDチップ122は、ガラス基板106の一方表面106aにおける中央部または任意の位置に形成された配線パターン126にバンプ124が導電性ペースト127を介して電気的に接続される。また、各ICチップ123は、LEDチップ122の両側に導電性ペースト110を介して、バンプ124をガラス基板106の一方表面106aに向けて、配線パターン126上に搭載される。

【0010】上述のようにガラス基板106上に搭載された各構成要素を保護するために、各構成要素を覆うようにカバー125を設置する。取付枠107はガラス基板106を囲む大きさに形成され、取付枠107の中央部にガラス基板106が嵌まり込む。取付枠107には、中央部に前記ガラス基板106に搭載されたLEDチップ122に沿って、一方表面107aからガラス基板106まで到達するように透孔107bが形成される。さらに、取付枠107の両端部にはそれぞれ2つず

3

つ取付穴108が形成される。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】高品位な表示を実現するためには表示ドット数の増加および表示密度の向上が必要となるが、第1の搭載法であるワイヤーボンディング方式によって各チップが接続された光半導体装置111では、表示ドット数が増加するとICチップ102とLEDチップ101とを接続する導線103の本数が増加し、また表示密度が高くなると導線103の接続が難しくなるので、接続不良の発生する割合が高くなり歩留りの低下を招く。

【0012】第2の搭載法であるフェイスダウンボンディング方式によって各チップが搭載された光半導体装置121では、各チップを配設する基板材料がガラスであるために、光半導体装置121を他の部材に取付ける場合に必要となる取付穴の形成などの2次加工が難しい。したがって、光半導体装置121を他の部材に取付けるにはガラス基板106とは別に取付穴108を形成した取付枠107が必要となり、構成部品の数が増え作業工程数も増加する。また、ガラス基板106は基板パターンを両面に形成することが困難であるので基板の片面にしか配線を行うことができず、設計上の制約が生じており、光半導体装置121の小型化が図りにくい。また、ガラス基板106は重量が重くなるので光半導体装置121の軽量化が図りにくい。

【0013】本発明の目的は、高密度の配線および実装を容易に行うことができ、かつ装置の小型化および軽量化を図ることができる光半導体装置を提供することである。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明は、表面に光半導 体素子および接続用バンプを備える光半導体チップと、 光半導体素子に対応する開口形状の透孔および接続用バ ンプに対応する電極パッドが一方表面側に設けられ、前 記透孔は他方表面側に向かって開口面積が増大するよう に形成される合成樹脂成型基板とを含み、前記光半導体 チップは、前記合成樹脂成型基板上に接続用バンプと電 極パッドとの間のフェイスダウンボンディングによって 搭載されることを特徴とする光半導体装置である。また 本発明は、前記光半導体チップには、光半導体素子とし てLEDアレイが形成され、前記合成樹脂成型基板に は、LEDアレイを構成する複数のLED素子に個別的 に対応して、複数のスリット状の透孔が形成されること を特徴とする。また本発明は、前記合成樹脂成型基板の 透孔には、光透過性の合成樹脂が充填されることを特徴 とする。

[0015]

【作用】本発明に従えば、光半導体装置は一方表面側から他方表面側に向かって開口面積が増大するように形成される透孔と、所定の間隔をあけて形成される電極パッ 50

ドとを備える合成樹脂成型基板上に、表面に光半導体素子および接続用バンプを備える光半導体チップを、前記電極パッドと接続用バンプとの間のフェイスダウンボンディングによって搭載する。したがって、光半導体チップの光半導体素子から出射される光は、合成樹脂成型基板に設けられた透孔を通って外部に出射される。

【0016】また好ましくは、前記光半導体チップには 光半導体素子としてLEDアレイが形成され、光半導体 チップが搭載される前記合成樹脂成型基板には、LED アレイを構成する複数のLED素子に個別的に対応する ように複数のスリット状の透孔が形成される。したがっ て、LEDアレイを構成するそれぞれのLED素子から 出射される光がそれぞれ対応する透孔から外部へと出射 される。

【0017】さらに好ましくは、前記合成樹脂成型基板の透孔には光透過性の合成樹脂が充填される。したがって前記透孔からゴミおよび異物が侵入することを防止し、光半導体チップを外界から保護することができる。

[0018]

【実施例】図1は本発明の第1実施例である光半導体装置21の平面図であり、図2は図1における切断面線II-IIから見た断面図であり、図3は図1における切断面線II-IIIから見た断面図である。

【0019】光半導体装置21は、基板1と、カバー2と、LEDチップ3と、ICチップ4,7とを含んで構成される。光半導体装置21においては、高密度の実装を行うためにフェイスダウン方式によって各素子を実装した。基板1は後述するようにして成型され、中央部には基板1の短辺方向に向けて形成されたテーパ状のスリット6が設けられる。また、基板1の4隅の近傍にはそれぞれ挿通孔5が設けられる。光半導体装置21を他部材に取付けるときには、挿通孔5にボルトなどが挿通されることによって固定される。基板1には所定のパターンである配線パターン9,14,15,16が形成される。

【0020】LEDチップ3には、接続用の電極に直径 $20\sim30\mu$ m程度である導電性の凸状のバンプ10 a, 10 bが形成される。同様に、ICチップ4;7にはそれぞれバンプ12a, 12 b; 13 a, 13 bが形成される。LEDチップ3は、スリット6の両側でバンプ10a, 10 bをそれぞれ配線パターン15, 16 に対向させ、導電性ペースト11を介して配線パターン15, 16 と電気的に接続される。ICチップ4は、バンプ12 bを配線パターン15に向け、バンプ12 a を配線パターン14に向け、導電性ペースト11を介してそれぞれ電気的に接続される。ICチップ7は、バンプ13 a を配線パターン16に向け、バンプ13 b を配線パターン9に向け、導電性ペースト11を介してそれぞれ電気的に接続される。

【0021】図4は、光半導体装置21におけるLED

20

40

50

6

チップ3周辺の平面図である。ICチップ4とLEDチップ3とは複数本の配線パターン15a, 15b, 15c, 15d, …によって接続され、ICチップ7とLEDチップ3とは複数本の配線パターン16a, 16b, 16c, 16d, …によって接続される。LEDチップ3にはLEDチップ3の長辺方向に向かって複数個の発光部8が形成されており、それぞれの発光部8a, 8b, 8c, …から出射された光はスリット6を通過して矢符18で示す出射方向へと出射される。

【0022】上述のように各構成要素が設けられた基板 10 1上に各構成要素を保護するためのカバー2を設ける。 LEDチップ3から出射される光は、基板1に設けられたスリット6から出射方向18に向かって外部へと放出されるために、カバー2は光の透過には関係がなくなり、透光性の材料を用いなくてもよい。

【0023】光半導体装置21においては、高密度の配 線、実装を実現するために基板1とそれぞれのチップと の接続をフェイスダウンボンディング方式によって行 う。フェイスダウンボンディング方式によってそれぞれ のチップを基板1に実装するためには、基板1は光を透 過することができ、かつ回路形成が容易であることが必 要となる。また、2次加工性を確保し、さらに軽量化を 図るために基板1の材料としてガラス以外の材料を用い る。基板1の材料として透明材であるポリカーボネイト 材もしくはアクリル材を用いた場合、両者とも熱可塑性 の樹脂であるので成型は可能であるが、樹脂表面のめっ き密着強度が低く配線パターンを形成することができな い。そのため、樹脂表面の密着強度が高い液晶ポリマ材 などを基板1の材料とし、発光部に該当する部分に光を 通過させるためのスリット6を基板1の成型時に設け る。基板1を成型する際には、成型樹脂は高流動性の樹 脂を用い、成型圧を高めに設定して充填不足が起きない ようにする。

【0024】スリット6を設けた基板1を成型する際に用いる金型の歯は、スリット6の幅が狭いために強度が低下する。また、スリット6となる部分に応力が集中しているため、金型を抜くときそれぞれのチップを実装する表面側が盛り上がってしまう。そのために、スリット6の形状を一方表面1a側から他方表面1b側に両積が増大するように形成する。たとえば、基板1の厚さが1. 0mmとした場合、発光部側である一方表面1a側のスリット幅を150~200 μ m、外部開口部である他方表面1b側のスリット幅を300~400 μ mとすると、一方表面1aにおけるスリット6周辺の面精度が損なわれることはない。また、同時に金型の歯の根元の部分に向かって幅広の形状となるので、金型の耐久性が向上する。

【0025】上述のように成型された基板1に、MID (Molded Interconnection Device) と呼ばれる手法によって配線パターン9,14,15,16を形成する。

光半導体装置 2 1 において求められるようなファインパターンの形成は、MIDの1つであるフォトプロセスを使用する PSP (Photo Selective Plating) 法によって行う。 PSP法においては、まず射出成型された基板に接着促進剤および感光剤を塗布し、めっきの核となる部分を選択形成する。次に、紫外線によって露光してポジティブパターンを形成する。さらにポジティブパターン 以外の部分を定着させ、無電解めっきによって配線パターンを形成する。

【0026】前述したように基板1は成型されるので、 従来では成型後に設けていた取付け部品などを成型時に 作り込むことが可能となる。

【0027】図5は本発明の第1実施例における他の構成例である光半導体装置22の平面図であり、図6は図5における切断面線VI-VIから見た断面図であり、図7は図5における切断面面VII-VIIから見た断面図である。

【0028】光半導体装置22において、前述した光半 導体装置21と同一の構成要素には同一の参照符を付し て説明を省略する。光半導体装置22においては、挿通 孔5に連通する挿通孔を有する円環状の台座23が基板 1と一体的に形成される。台座23を設けることによっ て、光半導体装置22を他の部材に取付ける際に、カバ 一2との高さの差が小さくなるので、基板1と他の部材 との間にさらに他の部材を挟み込まなくても取付けが容 易に行えるようになる。このように基板1は、必要に応 じて形状を任意に加工することができるので、取付け部 品の削減および簡素化を図ることができる。

【0029】以上のように本実施例によれば、光半導体装置21,22において、LEDチップ3は、基板1に設けられたテーパ状のスリット6に発光部8を向けて当該スリット6をまたいで配線パターン15,16にフェイスダウンボンディングによって接続され、各ICチップ4,7から電流を供給されることで光を出射方向18へと出射するので、各構成要素同士を導線を用いずに接続することができるので高密度の配線および実装を行うことができる。

【0030】図8は、本発明の第2実施例である光半導体装置24の断面図である。光半導体装置24において前述した第1実施例における光半導体装置21と同一の構成要素には同一の参照符を付して説明を省略する。本実施例における光半導体装置24の特徴は、基板1に設けられたスリット6およびLEDチップ3とICチップ4,7との隙間などを透光性樹脂25で充填することである。光半導体装置24においてLEDチップ3から出た光は、スリット6に充填された透光性樹脂25を介して出射方向18へと出射される。

【0031】上述のように光半導体装置24を構成することによって、LEDチップ3およびICチップ4,7と基板1との隙間が透光性樹脂25で充填されているの

で外部から加えられる力によってLEDチップ3および ICチップ4,7が配線パターンから外れるのを防止することができる。また、スリット6から光半導体装置24内にゴミおよび異物が侵入することを防ぐことができる。

【0032】図9は、本発明の第3実施例である光半導体装置28の断面図である。光半導体装置28において前述した第1実施例における光半導体装置21と同一の構成要素には同一の参照符を付して説明は省略する。

【0033】本実施例における光半導体装置28の特徴 10 は、基板1上に設けられた各構成要素をカバー2を用いずに透光性樹脂25によって覆って保護している点である。また、スリット6は透光性樹脂25によって充填される。透光性樹脂25の材料としては、カバー2の代わりとなり、強度および腐食防止に優れた材料を選ぶことが望ましい。光半導体装置28においてLEDチップ3から出た光は、スリット6に充填された透光性樹脂25を介して出射方向18~と出射される。

【0034】上述のように光半導体装置28を構成することによって、カバー2を取付けなくてもすむようになり、また光半導体装置28のそれぞれの構成要素が透光性樹脂25によって互いに固着されるので、外部から加えられる力によってLEDチップ3およびICチップ4,7が配線パターンから外れるのを防止することができる。

【0035】図10は、本発明の第4実施例である光半 導体装置31の断面図である。光半導体装置31におい て前述した第1実施例における光半導体装置21と同一 の構成要素には同一の参照符を付して説明を省略する。

【0036】本実施例における光半導体装置31の特徴30は、スリット6に充填される透光性樹脂25を基板1の他方表面1b側へと凸状に盛り上げで形成することである。

【0037】上述のように光半導体装置31を構成することによって、LEDチップ3から出た光は透光性樹脂25のレンズ作用によって一定の大きさにまとめられ出射方向18へと出射される。また、LEDチップ3およびICチップ4,7の隙間が透光性樹脂25で充填されているので外部から加えられる力によってLEDチップ3およびICチップ4,7が配線パターンから外れるのを防止することができる。

【0038】図11は、本発明の第5実施例である光半 導体装置34の断面図である。光半導体装置34において、前述した第1実施例における光半導体装置21と同 ーの構成要素には同一の参照符を付して説明を省略する。

【0039】本実施例における光半導体装置34の特徴は、スリット6およびそれぞれのチップと基板1との間を透光性樹脂25によって充填し、さらに基板1上に搭載された各構成要素を透光性樹脂25とは異なる樹脂3

5によって覆っていることである。樹脂35の材料としては、カバー2の代わりとなり、強度および腐食防止に優れた材料を選ぶことが望ましい。

【0040】上述のように光半導体装置34を構成することによって、カバー2を取付けなくてもすむようになり、またそれぞれの構成要素が樹脂35によって互いに固着されるので外部から加えられる力によってLEDチップ3およびICチップ4,7が配線パターンから外れるのを防止することができる。

【0041】なお、上述の各実施例においてスリット6に充填される透光性樹脂25は透明でも着色されてもよく、散乱剤を混ぜ、LEDチップ3から出射される光を散乱させるようにしてもよい。また、上述の各実施例においてLEDチップ3の代わりにCCD (Charge Coupled Device)などの受光素子を用いてもよい。

[0042]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、光半導体装置における合成樹脂成型基板には一方表面側から他方表面側に向けて開口面積が増大するように透孔を形成し、光半導体素子を当該透孔に向けて基板上にフェイスダウンボンディングによって配置し、光半導体素子から出射される光は透孔を経て外部へと放出されるので、高密度の配線および実装を行うことができる。また、基板の材料として合成樹脂が用いられているので、装置の小型化および軽量化を図ることができる。

【0043】また本発明によれば、光半導体チップには 光半導体素子としてLEDアレイが形成され、前記合成 樹脂成型基板には、LEDアレイを構成する複数のLE D素子に個別的に対応した複数のスリット状の透孔が形 成されるので、それぞれのLED素子から出射される光 がそれぞれの透孔から出射され、LED素子による表示 の視認性を向上させることができる。

【0044】さらに本発明によれば、前記合成樹脂成型 基板の透孔には光透過性の合成樹脂が充填されるので、 前記透孔からのゴミおよび異物の侵入を防止することが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例である光半導体装置21の 平面図である。

【図2】図1における切断面線II-IIから見た断面 図である。

【図3】図1における切断面線III-IIIから見た 断面図である。

【図4】光半導体装置21におけるLEDチップ3周辺の平面図である。

【図5】本発明の第1実施例における他の構成例である 光半導体装置22の平面図である。

【図6】図5における切断面線VI-VIから見た断面 図である。

【図7】図5における切断面線VII-VIIから見た

断面図である。

【図8】本発明の第2実施例である光半導体装置24の 断面図である。

9

【図9】本発明の第3実施例である光半導体装置28の 断面図である。

【図10】本発明の第4実施例である光半導体装置31の断面図である。

【図11】本発明の第5実施例である光半導体装置34 の断面図である。

【図12】ワイヤーボンドアッセンブルによってLED チップ101が接続された光半導体装置111の平面図 である。

【図13】図12における切断面線XIII-XIIIから見た断面図である。

【図14】図12における切断面線XIV-XIVから見た断面図である。

【図15】フェイスダウンボンディング方式によってL EDチップ122が接続された光半導体装置121の平* * 面図である。

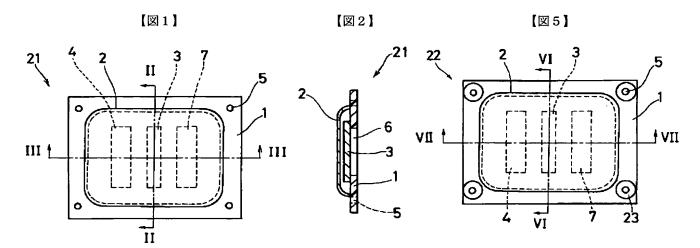
【図16】図15における切断面線XVI-XVIから 見た断面図である。

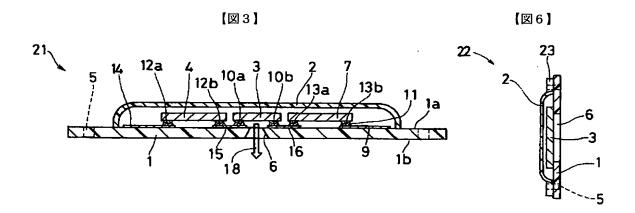
10

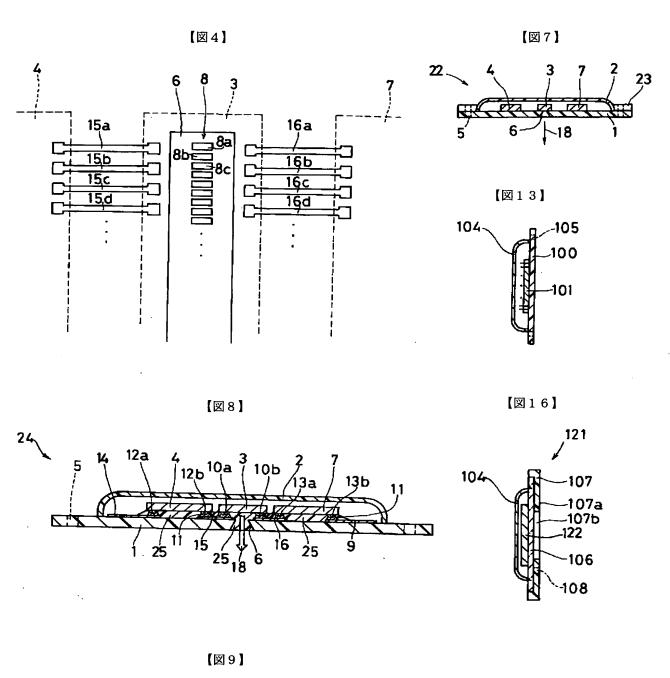
【図17】図15における切断面線XVII-XVIIから見た断面図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 カバー
- 3 LEDチップ
- 4, 7 I C チップ
- 6 スリット
 - 9 配線パターン
 - 10, 12, 13 バンプ
 - 11 導電性ペースト
 - 18 出射方向
- 21, 22, 24, 28, 31, 34 光半導体装置
- 25 透光性樹脂

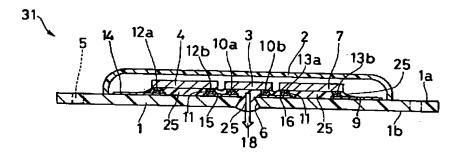




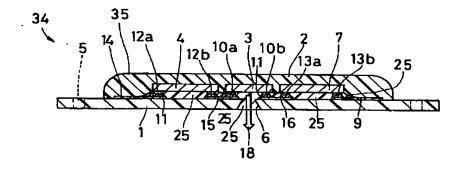


28, 12a 4 10a 3 10b 13a 7 13b 11 25 15 16 25 9

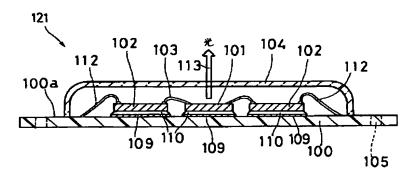
【図10】

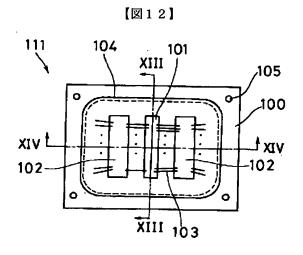


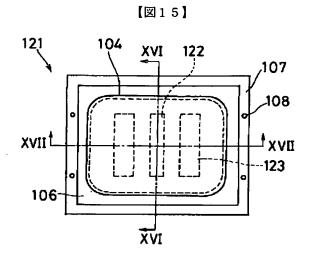
【図11】



【図14】







【図17】

